

О КИНЕТИКЕ РАСТВОРЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОБЛУЧЕННЫХ КРИСТАЛЛОВ

П. А. САВИНЦЕВ, А. Ф. НАУМОВ, И. Г. БЕРЗИНА

Образование дефектов в кристалле при облучении ведет к увеличению потенциальной энергии решетки [1, 2] и термодинамического потенциала кристалла. Запасенная при этом энергия должна изменить условия термодинамического равновесия кристалла с раствором. Повышение термодинамического потенциала Φ при облучении вызывает увеличение концентрации C_0 равновесного раствора над облученным кристаллом. Таким образом, облучение кристаллов увеличивает их растворимость и соответственно скорость растворения v .

При очень малых недосыщениях или пересыщениях ε маточного раствора и его интенсивном перемешивании скорость растворения и роста кристаллов становится пропорциональной ε^2 [3], где $\varepsilon = \frac{C_0 - C}{C_0}$, C — концентрация растворенного вещества в объеме раствора.

Пусть облученный и необлученный кристаллы растворяются в одинаковых условиях в одном и том же растворе. Недосыщение для необлученного кристалла обозначим через $\varepsilon_{необл.}$, а для облученного — через $\varepsilon_{обл.}$. Отношение скорости растворения облученного кристалла $v_{обл.}$ к скорости растворения необлученного кристалла $v_{необл.}$ будет равно

$$\frac{v_{обл.}}{v_{необл.}} = \frac{\varepsilon_{обл.}^2}{\varepsilon_{необл.}^2}, \quad (1)$$

где $\varepsilon_{обл.} / \varepsilon_{необл.}$ является величиной постоянной, не изменяющейся при изменении концентрации раствора.

Уравнение (1) показывает, что отношение $v_{обл.} / v_{необл.}$ должно резко возрасти при приближении концентрации раствора к концентрации насыщения относительно необлученного кристалла.

Изложенные соображения были подтверждены экспериментально при растворении облученных и необлученных кристаллов NaCl, KCl, KBr в их водных растворах. Растворение кристаллов осуществлялось следующим образом. В кристалле просверливалось цилиндрическое отверстие, сквозь которое проходила струя растворителя. Режим растворения изменялся путем изменения скорости протекания раствора через отверстие, а также при изменении длины и диаметра отверстия. Переход вещества из кристалла в раствор происходил через ламинар-

ный подслоя, прилегающий к поверхности растворения, толщина которого в конце участка стабилизации турбулентного течения равна

$$n = 64,2 \frac{d}{Re^{0,875}} \quad (2)$$

где d —диаметр отверстия, Re —критерий Рейнольдса [4].

При нестационарном течении струи раствора через отверстие в тонкой пластинке кристалла толщина ламинарного подслоя становится меньше определяемой по этой формуле.

Кристаллы щелочно-галогидных солей готовились для опытов в виде пластинок толщиной 0,93–0,01 мм. Скорость прохождения струи водного раствора соответствующих солей через цилиндрическое отверстие в центре пластинки диаметром 1,2 мм бралась такой, чтобы независимо от концентрации раствора критерий Рейнольдса оставался постоянным и равным 4000. При этом скорость струи раствора оказалась равной, примерно 4 м/сек.

Линейная скорость растворения находилась по формуле $v = \frac{d-d_0}{\tau}$,

где $d-d_0$ —приращение диаметра цилиндрического отверстия во время растворения кристалла, τ —время растворения. Концентрация раствора измерялась с помощью определения плотности раствора, которую находили путем взвешивания 100 мл раствора. Опыты проводились в термостатированном помещении при температуре 20°C.

Для облучения кристаллов использовалась рентгеновская установка УРС-70 с трубкой типа БСВ-4-Си. На трубку подавалось напряжение в 47,5 кВ при анодном токе 16 мА. Облучаемый кристалл находился на расстоянии 5 см от центра трубки и получал за одну минуту дозу в 130 р (пластинка кристалла устанавливалась перпендикулярно к направлению лучей).

Кроме облучения рентгеновскими лучами, были проведены опыты по исследованию таким же образом приготовленных пластинок кристаллов щелочно-галогидных солей, облученных нейтронами и γ -лучами от Ra- α -Be-источника. Образцы помещались в парафиновый блок, замедляющий нейтроны на расстоянии 15 см от источника. Активность источника $4 \cdot 10^6$ нейтронов в секунду. Время облучения от 40 до 70 часов. Растворение кристаллов проводилось сразу после конца облучения.

На рис. 1 показан рост отношения $v_{обл.}/v_{необл.}$ линейных скоростей растворения облученных и необлученных рентгеновскими лучами кристаллов каменной соли с увеличением дозы облучения при концентрации раствора NaCl в воде, равной 24, 25 и 26 % вес. По оси абсцисс кроме дозы облучения в рентгенах отложено также время, за которое кристалл получал соответствующие дозы. Как видно из рис. 1, рост скорости растворения облученных кристаллов при увеличении времени облучения замедляется. Это говорит вероятно о том, что скорость своеобразного отжига дефектов, появляющихся в кристалле при облучении, сравнивается при определенном времени облучения со скоростью образования новых дефектов в кристалле. Отношение $\frac{v_{обл.}}{v_{необл.}}$ растет с увеличением концентрации раствора (рис. 1, 2)

в то время, как абсолютная величина разности этих скоростей уменьшается.

Непосредственное измерение увеличения равновесной концентрации раствора ΔC_0 над кристаллом при его облучении затрудняется

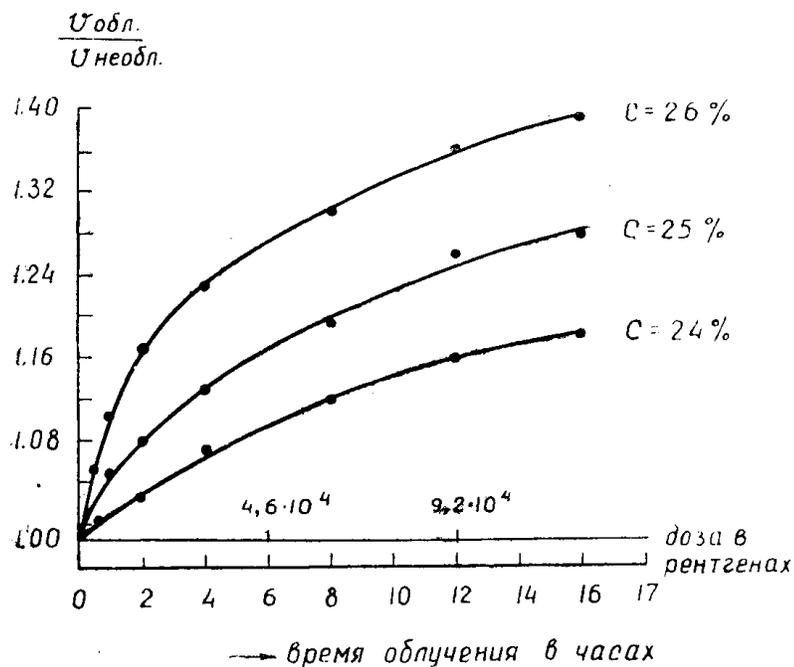


Рис. 1. Зависимость отношения скоростей растворения облученного рентгеновскими лучами и необлученного кристаллов NaCl от дозы облучения.

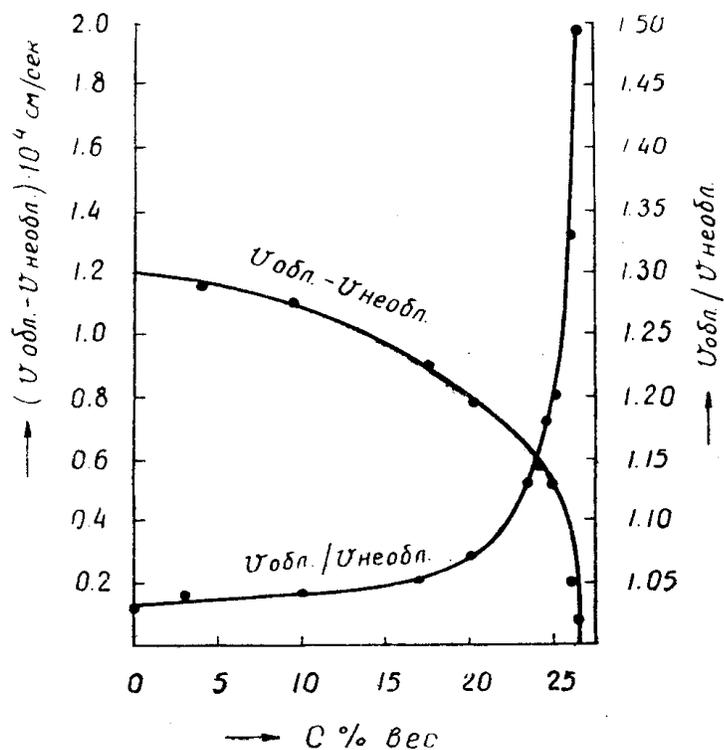


Рис. 2. Зависимость отношения и разности скоростей растворения облученного и необлученного кристаллов каменной соли от концентрации раствора.

тем, что в результате обмена частицами между облученным кристаллом и раствором происходит изменение слоев кристаллической решетки, контактирующих с раствором. Но приближенно вычисление можно провести по уравнению (1), используя данные рис. 2 по зависимости

ти $\frac{v_{обл.}}{v_{необл.}}$ от концентрации раствора. Приняв концентрацию раствора $C=25\%$ вес. ($\sigma_{необл.}=0,053$), $\frac{v_{обл.}}{v_{необл.}}=1,12$, получим $\Delta C_0 \approx 0,08\%$ вес.

Таким образом при температуре 20°C равновесная концентрация раствора NaCl в воде будет $26,40\%$ вес. над необлученным кристаллом и $26,48\%$ вес. над облученным (доза облучения рентгеновскими лучами $6 \cdot 10^4 \text{ p}$).

Из этих данных можно подсчитать приращение термодинамического потенциала кристалла NaCl при указанной дозе облучения. Величина $\Delta\Phi$ будет равна разнице между химическими потенциалами NaCl в растворах концентрации $26,48$ и $26,40\%$ вес., так как термодинамический потенциал Φ кристалла, рассчитанный на грамм/моль вещества, равен химическому потенциалу этого вещества μ в растворе равновесной концентрации. Описывая химический потенциал в обычной для реального вещества форме $\mu = \mu_0 + RT \ln fC$, где R — универсальная газовая постоянная, T — абсолютная температура, f — коэффициент активности, C — концентрация вещества в объеме, получим

$$\Delta\Phi = \mu_1 - \mu_2 = RT \ln \frac{fC_1}{fC_2} = RT \ln \frac{C_1}{C_2}, \quad (3)$$

где μ_1 и μ_2 — химические потенциалы растворенного вещества в растворе концентрации C_1 и C_2 соответственно.

Подставляя в уравнение (3) числовые данные нашего примера, получим увеличение термодинамического потенциала кристалла, приблизительно равное 2 кал./моль .

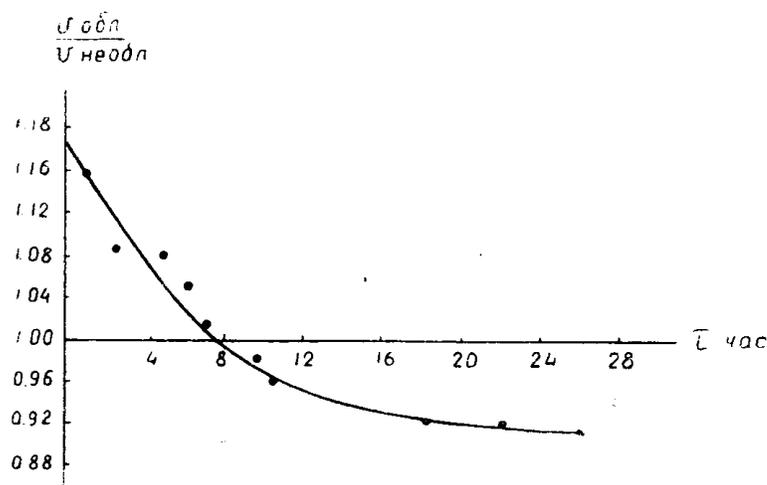


Рис. 3. Зависимость отношения скоростей растворения облученного от Ra- γ -источника и необлученного кристаллов NaCl от времени хранения образца при комнатной температуре.

Аналогичные результаты получены при растворении монокристаллов KCl и KBr, выращенных искусственно по методу Киропулоса.

Облучение рентгеновскими лучами вызывает в этих кристаллах увеличение скорости растворения тем более сильное, чем меньше энергия кристаллической решетки вещества.

На рис. 3 изображена зависимость отношения $\frac{v_{обл.}}{v_{необл.}}$ для кристаллов неотожженной каменной соли, облученной нейтронами и γ -лучами от Ra- α -Be-источника по описанной выше методике, от времени отжига образца при комнатной температуре, равной 20°C, после облучения. Концентрация раствора 25,85 % вес. NaCl в воде. При времени отжига до 8 часов $v_{обл.} > v_{необл.}$. При дальнейшем отжиге $v_{обл.} < v_{необл.}$.

Такой же характер имеет зависимость разности времен растворения необлученного и облученного поликристалла индия в жидком расплаве индий-олово от времени отжига индия при температуре 20°C. Кристаллы индия подвергались облучению от Ra- α -Be-источника при описанных выше условиях. Методика эксперимента описана в работе [5]. На рис. 4 изображена зависимость разности времен расплавления

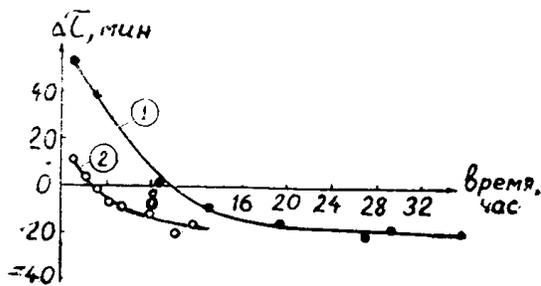


Рис. 4. Зависимость разности времен растворения необлученного и облученного от Ra- α -Be-источника кристаллов индия от времени хранения при комнатной температуре: 1—предварительно закаленный образец, 2—предварительно отожженный образец.

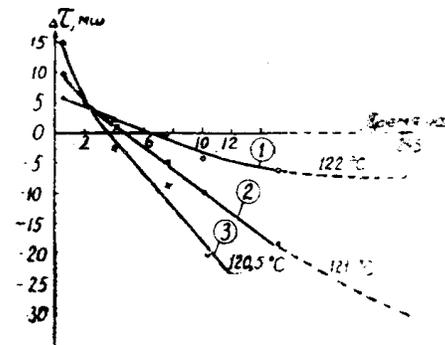


Рис. 5. Зависимость разности времен расплавления необлученного и облученного от Ra- α -Be-источника кристаллов индия от времени хранения при комнатной температуре для различных температур опыта.

ления необлученного и облученного индия $\Delta\tau = \tau_n - \tau_0$ от времени отжига при комнатной температуре для закаленных (1) и отожженных (2) при комнатной температуре в течение месяца до облучения кристаллов индия. Температура опыта 121,5 С. Время облучения 40 часов. Как видно из графика, разность времен расплавления необлученного и облученного кристаллов, а следовательно, и число наводимых дефектов при одинаковых условиях облучения в закаленных кристаллах индия значительно больше, чем в отожженных. Движение дефектов в кристаллах, блокирование ими со временем дислокаций [6] приводит к упрочнению кристаллов NaCl (рис. 3) и кристаллов индия (рис. 4), хотя механизм образования дефектов в этих двух случаях видимо различен.

На рис. 5 показана зависимость $\Delta\tau$ от времени отжига при 20°C для различных температур опыта для облученных и необлученных кристаллов индия. Как видно из рисунка, при приближении температуры опыта к температуре начала контактного плавления [7] величина $\Delta\tau = \tau_n - \tau_0$ со временем увеличивается по абсолютной величине и происходящий процесс достигает равновесия через большие промежутки времени.

Таким образом, радиационные дефекты в кристаллах приводят к увеличению скорости растворения твердых тел в жидкостях. Это яв-

ление можно использовать для определения $\Delta\Phi$ в облученных кристаллах. Для кристалла каменной соли, облученного рентгеновыми лучами ($6 \cdot 10^4$ рентген), $\Delta\Phi \approx 2$ кал/моль.

ЛИТЕРАТУРА

1. Динс Л., Бивий ард Л. Радиационные эффекты в твердых телах, ИЛ, М., 1960.
2. Newgard I. L., I. Appl. Phys., 30, № 9, 1449-1451, 1959.
3. Чернов А. А. ДАН СССР, 133, № 6, 1960.
4. Воронин Г. И. Основы термодинамики и теплопередачи. Оборонизд., стр. 290, 1958.
5. Берзина И. Г., Савиццев П. А. Действие излучения на контактное плавление кристаллов (статья помещена в этом томе).
6. F. Seitz., Rev. Mod. Phys., 26, 7, 1954.
7. Берзина И. Г., Наумов А. Ф., Савиццев П. А. Кристаллография, 6, 466, 1961.